

2024年10月11日

米国オハイオ州立大学による当社製 MOCVD および HVPE 装置採用決定についてのお知らせ

日本酸素ホールディングスグループの日本産業ガス事業会社である大陽日酸株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役社長：永田 研二）は、米国のオハイオ州立大学に当社製 MOCVD 装置^{※1}および HVPE 装置^{※2}を納入することが決定しましたのでお知らせいたします。

オハイオ州立大学は、ワイドバンドギャップ半導体^{※3}分野において世界的に著名な研究機関であり、特に窒化ガリウムや酸化ガリウムなどの次世代パワーデバイス材料に関する研究で卓越した実績を誇ります。同大学では、数多くの優秀な研究者が集まり、活発な研究が行われています。

このたび当社は高性能な化合物半導体デバイスの製造に不可欠な窒化物用 MOCVD 装置 (SR4000HT-RR-LV) と酸化物用 HVPE 装置を納入致します。これらの装置は、同大学の研究開発を加速し、最先端の化合物半導体デバイスの実現に貢献することが期待されます。当社は同大学と強固な協力関係を築くことで、研究開発を加速しグローバル市場に対する当社製 MOCVD 装置の優位性をさらに高めてまいります。

※1 MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition) 装置：原料に有機金属やガスを用いながら基板上に化合物半導体の成膜を行う装置。

※2 HVPE (Halide Vapor Phase Epitaxy) 装置：原料に金属塩化物ガスと非金属の水素化物ガスを用いながら基板上に半導体の成膜を行う装置。

※3 ワイドバンドギャップ半導体：窒化ガリウムなど、電子が価電子帯から伝導帯に遷移するためのエネルギー値が高い半導体。その特性は、高温での動作や高電圧での動作に優れ、高電力・高周波アプリケーションや高温環境での使用に適しているとされている。

以上

【会社概要】

大陽日酸株式会社

事業内容：酸素・窒素・アルゴン等各種産業ガス、LP ガス、医療用ガス、特殊ガスの製造・販売
及び溶断機器・材料、各種ガス関連機器、空気分離装置の製造・販売、電子部品の組立・加工・検査、設備メンテナンス

創業：1910年10月30日

設立：2020年2月4日

資本金：15億円

株主：日本酸素ホールディングス株式会社（出資比率 100%）

売上収益：4,143億円[※]

※日本酸素ホールディングス(株)2024年3月期の日本セグメントの売上収益

本件に関するお問い合わせ

大陽日酸株式会社
東京都品川区小山 1-3-26
広報部
TEL: 03-5788-8015
Mail: Tnsc.Info@tn-sanso.co.jp

製品に関するお問い合わせ

大陽日酸株式会社
イノベーションユニット
CSE事業部
TEL: 045-872-1822
Mail: mocvd@tn-sanso.co.jp